

集束イオンビーム・走査型電子顕微鏡加工観察装置(日本電子社製 JIB-4600F、JED-2300F)

製造元	日本電子(株)
仕様	Ga イオンビーム、二次電子像分解能 1.2 nm(加速電圧 30 kV)
保有部署	材料化学専攻 無機構造化学分野
設置場所	桂・A2棟・化学系 コアラボ
利用期間・時間、 利用料金	本設備の共同利用規程を参照 https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/sg65gg/
注意事項等	利用申請前に利用の概略を下記連絡先に必ずお知らせいただき承認を得てください。
連絡先	材料化学専攻 無機構造化学分野 助教 清水雅弘 075-383-2463 shimizu.masahiro.3m (at) kyoto-u.ac.jp http://func.mc.kyoto-u.ac.jp/ 利用申請前に利用の概略をこちら宛に必ずお知らせいただき承認を得てください。
キーワード	ナノ構造観察、微細加工、元素分析
機器コード	0000110003
自由記入欄	FIBによる高速断面加工後の高分解能 SEM 観察、EDS(エネルギー分散型 X 線分析装置)による元素マッピングが可能(オプション: 試料ピックアップシステム)

